

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成23年3月31日(2011.3.31)

【公表番号】特表2010-522102(P2010-522102A)

【公表日】平成22年7月1日(2010.7.1)

【年通号数】公開・登録公報2010-026

【出願番号】特願2009-554625(P2009-554625)

【国際特許分類】

B 2 9 C 59/16 (2006.01)

B 3 2 B 27/00 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

B 2 9 C 59/02 (2006.01)

B 2 9 C 33/38 (2006.01)

【F I】

B 2 9 C 59/16 Z N M

B 3 2 B 27/00 Z

G 0 3 F 7/20 5 0 5

B 2 9 C 59/02 B

B 2 9 C 33/38

【手続補正書】

【提出日】平成23年2月9日(2011.2.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材と、

前記基材にオーバーレイする光熱変換層と、

を含んでなり、

L I T E フィルムの表面が、その上に選択的にエンボス加工された微細構造化表面を有することができる、

レーザー励起熱エンボス加工(L I T E)フィルム。

【請求項2】

微細複製工具を製作する方法であって、

基材と前記基材にオーバーレイする光熱変換層とを含む、レーザー誘起熱エンボス加工(L I T E)フィルムを提供すること、

前記光熱変換層が前記微細構造に接触した状態で、微細構造のパターンを含むマスター工具に、前記L I T E フィルムをラミネートすること、

前記L I T E フィルムをパターンごとに画像化して、前記光熱変換層を選択的に露光すること、

前記マスター工具を取り除いて、前記L I T E フィルム上に、前記マスター工具の前記微細構造に対応する微細構造化パターンを製造することと、

を含んでなる、方法。

【請求項3】

構造化された転写層を有する熱ドナーフィルムを製造する方法であって、

基材と前記基材にオーバーレイする光熱変換層とを含むレーザー誘起熱エンボス加工(

LITE) フィルムを提供することと、

前記光熱変換層が前記微細構造に接触した状態で、微細構造のパターンを含むマスター工具に、前記 LITE フィルムをラミネートすることと、

前記 LITE フィルムをパターンごとに画像化して、前記光熱変換層を選択的に露光することと、

前記マスター工具を取り除いて、前記 LITE フィルム上に、前記マスター工具の前記微細構造に対応する微細構造化パターンを製造することと、

前記 LITE フィルム上の前記微細構造化パターンに、転写層を適用することと、
を含んでなり、

前記 LITE フィルムが、レセプタと密接に接触して保持されると同時に、前記転写層が前記レセプタに対して保持されている間に、前記 LITE フィルムが照射される場合に、前記レセプタに前記転写層の一部の転写を生じる、方法。